

■ 公募情報

公募No.	2026T-166
職種	有期研究技術員
部署	先端ICTデバイス研究開発推進センター
業務名	先端ICTデバイスラボ（本部）の設備・装置類の運営サポート業務
業務内容	先端ICTデバイス研究開発推進センター（以下、デバイスセンターという）は、埃の非常に少ない状態に維持されたクリーンルーム（プロセス室）を備え、各種の加工プロセスや評価測定のための設備・装置群が配備されています。半導体や誘電体材料を用いたデバイス等の試作により、先端的デバイス研究の推進に寄与しています。なお、デバイスセンター内には、特に危険をともなう装置（高圧ガス等を用いるドライエッチング装置、高温電気炉装置、高電圧装置や各種試薬を用いる実験装置等）が設置されています。業務内容は、①装置等を利用した研究用デバイスの作製とプロセス条件出し、②デバイスの光電気的特性評価、③デバイスセンター独自のデバイス加工・計測技術の検討と創出、④デバイスの光電気的特性評価、⑤エッチング等のデバイス加工装置や露光装置および光・高周波計測装置の運転・整備、⑥運営管理のための機構内における諸手続きや管理業務等を実施、及びデバイスセンターの推進チームメンバー（正副デバイスセンター長とエキスパート）の補佐としてデバイスセンター運営管理の実施を円滑に進める業務をして頂くものです。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格がありません。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバイス製造装置等を用いたデバイス作製・評価の経験、もしくはそれらデバイス加工装置等のメンテナンス経験を有すること。</li> <li>■ クリーンルーム施設に関連して、1. 設備、2. 装置、3. 薬品、4. 高圧ガス、5. 備品（IT機器、什器）等の管理に関する知識や取り扱い経験、安全管理ノウハウを有することが望ましい。</li> <li>■ 半導体デバイス作製プロセス技術等クリーンルーム内で実施されている研究概要の習得に意欲的に取り組めることが望ましい。</li> <li>■ コミュニケーション能力：報告・連絡・相談を上司の求める時間レベルに合わせて実施できること。</li> <li>■ コンピュータを用いた表計算の活用、プレゼン・報告資料の作成ができる、または関心を持って意欲的に取り組めることが望ましい。</li> <li>■ 情報処理・分析として、情報を収集、取捨選択、報告相手のレベルに合わせた情報をまとめる能力を有する、または関心を持って意欲的に取り組めることが望ましい。</li> <li>■ IT機器やソフトウェア等を用いた業務効率化に向けた検討等に関心を持って意欲的に取り組めることが望ましい。</li> </ul>
募集人員	1 人
本年度契約期間	採用日 ～ 令和9年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年
給与（基本給）	485,000円 ～ 516,000円/月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名称	本部 （東京都小金井市）
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務） ※時間外労働有

※従事する業務及び勤務地の変更の範囲：原則として変更無し

※部署の名称、勤務地の名称、及び業務名や業務内容内の表現に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。